

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일
2012년 5월 24일 (24.05.2012)



(10) 국제공개번호
WO 2012/067349 A2

- (51) 국제특허분류:
C08F 20/10 (2006.01) C08L 33/04 (2006.01)
C08F 22/06 (2006.01) G03F 7/027 (2006.01)
C08F 12/14 (2006.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2011/007655
- (22) 국제출원일: 2011년 10월 14일 (14.10.2011)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보:
10-2010-0114558 2010년 11월 17일 (17.11.2010) KR
10-2011-0024347 2011년 3월 18일 (18.03.2011) KR
- (71) 출원인 (US을(를) 제외한 모든 지정국에 대하여): **동진 세미켄 (DONGJIN SEMICHEM CO., LTD.)** [KR/KR]; 인천광역시 서구 가좌동 472-2, 404-250 Incheon (KR).
- (72) 발명자: **김**
- (75) 발명자/출원인 (US에 한하여): **한만호 (HAN, Man Ho)** [KR/KR]; 인천광역시 서구 가좌동 472-2, 404-250 Incheon (KR). **박종경 (PARK, Jong Kyoung)** [KR/KR]; 인천광역시 서구 가좌동 472-2, 404-250 Incheon (KR). **김현진 (KIM, Hyun Jin)** [KR/KR]; 인천광역시 서구 가좌동 472-2, 404-250 Incheon (KR). **김재현 (KIM, Jae Hyun)** [KR/KR]; 인천광역시 서구 가좌동 472-2, 404-250 Incheon (KR).

(74) 대리인: **리앤목특허법인 (Y.P.LEE, MOCK & PARTNERS)**; 서울시 서초구 서초동 1575-1, 137-875 Seoul (KR).

(81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

— 국제조사보고서 없이 공개하며 보고서 접수 후 이를 별도 공개함 (규칙 48.2(g))

(54) Title: POLYMER COMPOUND, AND RESIST-PROTECTING FILM COMPOSITION INCLUDING SAME FOR A LIQUID IMMERSION EXPOSURE PROCESS

(54) 발명의 명칭 : 고분자 화합물 및 이를 포함하는 액침 노광 프로세스용 레지스트 보호막 조성물

(57) Abstract: Provided are a polymer compound, and a resist-protecting film composition including same for a liquid immersion exposure process.

(57) 요약서: 고분자 화합물 및 이를 포함하는 액침 노광 프로세스용 레지스트 보호막 조성물이 제시된다.



WO 2012/067349 A2